NEW EPISULFIDE COMPOUND

Patent Number:

JP11180977

Publication date:

1999-07-06

Inventor(s):

AMETANI SHOICHI; TAKEUCHI MOTOHARU

Applicant(s):

MITSUBISHI GAS CHEM CO INC

Requested Patent:

IP11180977

Application Number: JP19980224770 19980807

Priority Number(s):

IPC Classification:

C07D331/02; C08G59/30; C08G75/06; G02B1/04; G02C7/02

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject new compound having one or more episulfide structure each containing three-membered ring structure-constituting sulfur atoms in a specific value or larger, capable of simultaneously imparting high heat resistance and high strength to optical material having good balances between reflective indexes and Abbe numbers, and useful as a raw material for spectacle plastic lenses.

SOLUTION: A compound of formula II (X is S or O wherein the number of S atoms is on the average >=50% based on the total number of the S and O atoms in X; R<1> -R<3> are each H or a 1-10C hydrocarbon group; R<4> is a 0-10C hydrocarbon chain) excluding a compound of formula I [Eps is a (thio)glycidyl group wherein the number of S atoms is on the average >=50% based on the total number of the S and O atoms in the group; (I) is 1-6; (m) is 0-4], etc. For example, 2,6-dimethyl-1,2:6,7-diepithio-4-thiaheptane. The compound of formula II is obtained by reacting a mercapto-containing compound with a (alkyl) epihalohydrin in the presence of an alkali and subsequently reacting the obtained compound of formula II (X is O) with a thio group-introducing agent such as a thiocyanate salt.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-180977

(43)公開日 平成11年(1999)7月6日

-	(51) Int.Cl. ⁶	讚別記号		FI		-			
•	C 0 7 D 331/02	BAD I HE - J		C07E	\ 22°	1 /00			
									•
	C 0 8 G 59/30			C 0 8 C					
	75/06	• •				5/06			
	G 0 2 B 1/04			G 0 2 E	3 1	1/04			
	G02C 7/02			G 0 2 C	7	7/02			
			審査請求	未請求 請	求項	の数 5	OL	(全 25 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平10-224770		. (71)出版	買人	000004		株式会社	
٠. ((22)出顧日	平成10年(1998) 8月7日		(TO) PA	···	東京都	千代田	株式芸社 区丸の内2丁	目5番2号
	On the the life about on the	************************		(72)発明	月百		•		
	31)優先権主張番号								番1号 三菱瓦
	32) 優先日	平9 (1997)10月16日						社東京研究所	内
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明	用者	竹内	基暗		
		•				東京都	葛飾区	新宿6丁目1	番1号 三菱瓦
						斯化学	株式会	社東京研究所	内
	w.e]				,	

(54) 【発明の名称】 新規なエピスルフィド化合物

(57)【要約】

【課題】 良好な屈折率とアッベ数のバランスを有する 光学材料に高い耐熱性と強度を同時に付与した新規な合 硫黄化合物を提供すること。

【解決手段】下記(1)式で表される構造を少なくとも 1個以上有する新規なエピスルフィド化合物。

$$\begin{bmatrix} \{K 1\} \\ R \\ -C \\ -C \\ -R \\ -S - \end{bmatrix}$$
 (1)

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記(1)式で表されるエピスルフィド構

造を1個以上有する化合物。

(2)

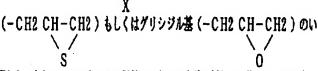
【化1】

(式中、XはSまたはOを表し、CのSの個数は三員環を構成するSとOの合計に対して平均でS0%以上である。 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ炭素数 $1\sim10$ の炭化水素基または水素を示し、 R^4 は炭素数 $0\sim10$ の炭化

水素鎖を表す。ただし、下記(2)式および(3)式で表されるエピスルフィド化合物と環状骨格を有するエピスルフィド化合物を除く。)

|素数0~10の炭化 【化2】 | **EpsS ((CH2) | IS)** m**Eps**

(式中、1は1から6の整数を表し、mは0から4の整数を表す。 さらに、Epsは-CH2CH-CH2基を表し、具体的にはチオグリシジル基



ずれかであり、このX中のSの個数はSと0の合計に対して平均で50%以上である。)

【化3】

【請求項2】請求項1記載の化合物を製造する方法。 【請求項3】請求項1記載の化合物を重合硬化して得ら

【請求項4】請求項1記載の化合物を重合硬化して得られる光学材料。

【請求項5】請求項1記載の化合物を重合硬化して樹脂 光学材料を得る方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

れる樹脂。

【産業上の利用分野】本発明のエピスルフィド化合物は、プラスチックレンズ、プリズム、光ファイバー、情報記録基盤、フィルター等の光学材料、中でも、眼鏡用プラスチックレンズの原料として好適に使用される。

[0002]

【従来の技術】プラスチック材料は軽量かつ靭性に富み、また染色が容易であることから、各種光学材料、特 50

に眼鏡レンズに近年多用されている。光学材料、特に、 眼鏡レンズに要求される性能は、光学性能としては高屈 折率と高アッベ数であり、物理的性能としては高耐熱性 と高強度である。高屈折率はレンズの薄肉化を可能と し、高アッベ数はレンズの色収差を低減し、高耐熱性と 高強度は二次加工を容易にするとともに、薄肉化、安全 性等の観点から重要である。従来技術における高屈折率 を有する材料は、ポリチオール化合物とポリイソシアネ ート化合物との反応により得られるチオウレタン構造を 有する熱硬化型光学材料(特公平4-58489号公 報、特開平5-148340号公報)等に提案されてい る。さらには、エポキシ樹脂またはエピスルフィド樹脂 を2官能以上の化合物と重合しレンズを得る技術も、特 開平1-98615号公報、特開平3-81320号公 報、国際公開wo8910575に提案されている。し かし、さらに高い屈折率が望ましいことは言うまでもな

い。一方、光学材料に要求されるもう一つの重要な性能として色収差が少ないことが挙げられる。色収差はアッベ数が高い程良好となるため高アッベ数材料が望まれる。すなわち、高屈折率と高アッベ数の同時実現も望まれている。しかしながら、一般に、アッベ数は屈折率の上昇に伴い低下する傾向を示し、従来技術の化合物を原料とするプラスチック材料では、屈折率1.50から1.55の場合アッベ数は約50から55が、屈折率1.60の場合40、屈折率1.66の場合31程度が限界であった。

【0003】さらに、従来技術、特にチオウレタン材料 等の場合、高屈折率発現のためには原料硫黄化合物の分 子量が大となり、このため架橋密度が低下し、高アッベ 数発現のためにはアルキル基含有量が増加し、このため 原料化合物を構成する分子の剛直性が低下し、結果とし て耐熱性が低下する。つまり、従来技術により得られる エピスルフィド化合物、ポリチオール化合物とイソシア ネート化合物による光学材料では、高い屈折率とアッベ 数と十分に髙い耐熱性のバランスが得られなかった。こ の問題を解決するために、本願発明者らは屈折率1.7 0程度の場合アッベ数36程度を有する光学材料を可能 とするエピスルフィド構造を有する新規な直鎖状(特開 平9-71580)、分岐状(特開平9-11097 9)、環状(特願平9-6790)の含硫黄化合物を見 いだし、先に特許出願を行った。これらの化合物から得 られる光学材料は光学物性は十分に高いものでありか つ、プラスチックレンズ材料に通常要求される耐熱性と 強度に関しては満足されるものであった。

【0004】しかしながら、耐熱性に関しては、レンズ加工時の熱履歴、および使用環境を考慮した場合さらに改良が望ましいことは言うまでもなく、強度に関しても安全性の面から一層の改良が望ましいことは言うまでもない。耐熱性が十分に高い場合、レンズの染色やコート等の加工時に熱変形やコートクラックが発生しにくく歩留まり、品質向上に有利である。さらに強度が十分高い場合、眼鏡用レンズとしての安全性が向上するばかり

見いだしたエピスルフィド構造を有する新規な含硫黄化合物は、屈折率1.70程度の場合アッベ数36程度を有する高光学物性材料が得られ、しかも耐熱性、強度も必要性能を満たしているが、主鎖が単純な構造でかつポリスルフィド構造だけから成るために耐熱性および強度の一層の改良には限界があった。このため、主鎖構造上の何らかの改良が必要であり、ひいては、主鎖を構成する新規な硫黄化合物の発明が必要な状況にあった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとする課題は、良好な屈折率とアッベ数のバランスを有する光学材料に高い耐熱性と強度を同時に付与した新規な含硫黄化合物を見いだすことにある。従来技術により得られるエピスルフィド化合物による光学材料では、高屈折率化は満足されるものの、単独では十分に高い耐熱性と強度が同時に得られないことに課題があった。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは高光学物性を有する光学材料に高い耐熱性と強度を同時に付与することを検討した結果、本発明の課題は下記(1)式で表される構造を少なくとも1個以上有する新規なエピスルフィド化合物から得られる光学材料により解決することが明らかになった。

$$\begin{bmatrix} \mathbb{R}^{4} \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{R}^{2} \quad \mathbb{R}^{1}$$

$$\mathbb{R}^{3} - \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} - \mathbb{R}^{4} - \mathbb{S} - \tag{1}$$

(式中、XはSまたはOを表し、CのSの個数は三員環を構成するSとOの合計に対して平均で50%以上である。 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ炭素数 $1\sim1$ 0の炭化水素基または水素を示し、 R^4 は炭素数 $0\sim1$ 0の炭化水素鎖を表す。ただし、下記(2)式および(3)式で表されるエピスルフィド化合物と環状骨格を有するエピスルフィド化合物を除く。)

【化5】

【化6】

6 ((CH2) nH) x (EpsSCH2 CH2 S) u-C- (CH2 SEps) y (3) (CH2 SCH2 CH2 SBps) z (式中、xは0~1の、yは0~4の、zは0~4の、uは0~1の、nは0~ 3の整数を表し、かつ、x+y+z+u=4の関係を満たす。 さらに、Epsは-CH2 CH-CH2 基を表し、具体的にはチオグリシジル基 (-CH2 CH-CH2) もしくはグリシジル基 (-CH2 CH-CH2) のい 0 ずれかであり、このX中のSの個数はSとOの合計に対して平均で50%以上で ある。)

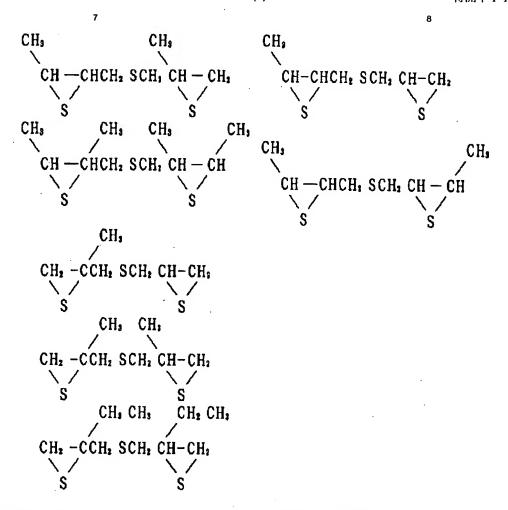
上記(1)式で表される構造を少なくとも1個以上有す る新規なエピスルフィド化合物は、直鎖状、分岐状、エ ステル結合等の含有等を問わずに本発明の効果が得られ る。また、(1)式で表される構造を少なくとも1個以 上有する新規なエピスルフィド化合物は、(1)式で表 される構造が好ましくは両者合わせて2個以上あるこ と、または(1)式で表される構造1個と(1)式で表 される以外のエピスルフィド構造が1個以上あることが 耐熱性を高める面から望ましい。(1)式において、X はSまたは〇を表すが、このSの個数は三員環を構成す るSと〇の合計に対して平均で50%以上であり、好ま しくは70~100%、より好ましくは80~100 %、特に好ましくは 1 0 0 % である。 R¹ 、 R² 、 R³ はそれぞれ炭素数1~10の炭化水素基または水素を表 すが、好ましくは炭素数1~6の炭化水素基または水素 であり、より好ましくは炭素数1~4の炭化水素基また は水素である。また、R4 は炭素数0~10の炭化水素 鎖を表すが、好ましくは炭素数1~8の炭化水素基また は水素であり、より好ましくは炭素数1~10の炭化水 素基または水素である。(1)式において、X中のSの 個数は三員環を構成するSとOの合計に対して平均で8 0%以下、特に50%以下の場合、硫黄含有量が低下し 高屈折率が達成されず、さらに化合物の反応性低下に伴

5

い高温条件下での重合が必要となるために材料に着色が 生じる。また、R¹、R²、R³のうちいずれかもしく は複数が炭素数7~10の炭化水素基の場合、硫黄含有 量が低下し高屈折率が達成されない。R4 は炭素数0~ 10の炭化水素鎖を表すが、これは分岐状でも環状を含 んでも構わない。R4 の炭素数が7~10の炭化水素基 では硫黄含有量が低下し髙屈折率が達成されずさらに耐 熱性が低下し、0の場合は化合物が不安定となる。これ らR¹ 、R² 、R³ およびR⁴ の炭化水素基の炭素数を 骨格構造に合わせて適当に選択することにより、より詳 細な屈折率とアッベ数のバランスの制御が可能である。 【0007】本発明の化合物およびこれを重合硬化して 得られる光学材料の性能は以上のように R¹、 R²、 R 3 、R⁴ の数およびX中のSの割合により決定される。 好ましい例としてエピスルフィド環上アルキル置換型エ ピスルフィド化合物、骨格アルキル置換型エピスルフィ ド化合物、分岐ポリスルフィド型エピスルフィド化合 物、エステル構造含有エピスルフィド化合物等が挙げら れる。これらの好ましい具体例のいくつかを例示的に以 下に実際に示す。

【0008】エピスルフィド環上アルキル置換型エピス ルフィド化合物の好ましい具体例としては、

【化7】



等の化合物が挙げられる。

【0009】骨格アルキル置換型エピスルフィド化合物 30

の好ましい具体例としては、

【化8】

EpsCH₂ SEps EpsCH₂ SCH₂ Eps EpsCH₂ SCH₃ CH₄ SCH₂ Eps EpsCH₂ SCH₂ CH₄ SCH₄ Eps

CH₃ CH₂ CH₈ CH₈ CHCH₃ EpsSCHCH: SEps EpsSCHCH2 SEps EpsSCHCH2 SEps CH, C (CH,) CH, H₃ C CH₃ H₃ C CH, EpsSCHCH: SEps **Eps S C H C H S Eps** EpsSCCH2SEps CH₃ H, C CH, EpsSCHCH: CH2 SEps EpsSCHCHCH2 SEps

H₂ C CH₂
| E₃ S C H C H₂ C H S E₃ S C H C H₂ C H - C H₂ 基を表し、具体的にはチオグリシジル基

X
(-C H₂ C H - C H₂) もしくはグリシジル基 (-C H₂ C H - C H₂) のい
S
であり、このX中のSの個数はS と O の合計に対して平均で50%以上である。

等の化合物が挙げられる。

【0010】分岐ポリスルフィド型エピスルフィド化合

物の好ましい具体例としては、 【化9】

11

CH: SEps

EpsSCH2 CH2 SCH2 CHSEps

Eps SCH₂ CH₂ SEps

EpsSCH2 CHSCH2 CHSEps

EpsSCH₂ CH₂ SEps

EpsSCHCH2 SCH2 CHSEps

EpsSCH₂ CH₂ SEps

EpsSCH2 CH2 SCH-CHSEps

EpsSCH₂ SCH₂ Eps

EpsSCH₂ CHSCHCH₂ SEps

Eps S S Eps

EpsSCH2 CHCHCH2 SEps

Eps S S Eps

EpsSCH₂ CHCHCH₂ SCH₂ CH₂ SEps

CH₂ SEps

EpsSCH₂ CHSCH₂ CH₂ SCH₂ CH₂ SEps

CH₂ SEps

EpsSCHCH2 SCH2 CH2 SCH2 CH2 SEps

EpsSCH₂ CH₂ SEps

EpsSCH₂ CH₂ SCHCHSCH₂ CH₂ SEps

EpsSCH2 CH2 SCH2 CH3 SCH2 CH2 SEps

EpsSCH2 CH2 SCHCHSCH2 CH2 SEps

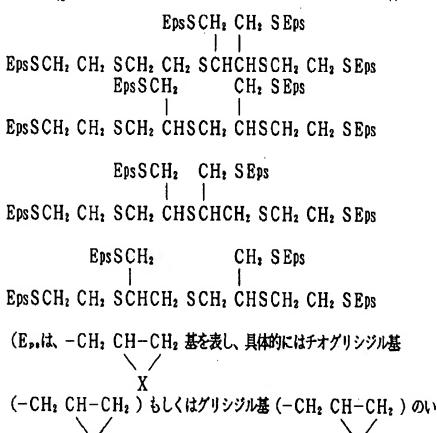
CH₂ SEps

EpsSCH2 CH2 SCH2 CH2 SCH2 CHSCH2 CH2 SEps

CH2 SEps

EpsSCH2 CH2 SCH2 CH2 SCHCH2 SCH2 CH2 SEps

【化10】



ずれか等の化合物が挙げられる。

【0011】エステル構造含有エピスルフィド化合物の 好ましい具体例としては、β-エピチオプロパノール オプロパノール(β-エピチオプロピルチオプロピオネ ート)、β-エピチオプロパノール (β-エピチオプロ ピルチオブテネート)、β-エピチオプロピルチオエタ ノール(β-エピチオプロピルチオアセテート)、β-エピチオプロピルチオエタノール(β-エピチオプロピ ルチオプロピオネート)、β-エピチオプロピルチオエ ーエピチオプロピルチオエチルチオエタノール (β-エ ピチオプロピルチオアセテート)、β-エピチオプロピ 40 ルチオエチルチオエチルチオール (β-エピチオプロピ ルチオプロピオネート)、β-エピチオプロピルチオエ チルチオエチルチオール (β-エピチオプロピルチオブ テネート)、 β -エピチオプロピルチオ酢酸無水物、 β ーエピチオプロピルチオプロピオン酸無水物、 B ーエピ チオプロピルチオ酪酸無水物、エチレングリコールビス (β-エピチオプロピルチオアセテート)、エチレング リコールビス (β-エピチオプロピルチオプロピオネー ト)、プロピレングリコールビス(β-エピチオプロピ ルチオアセテート)、プロピレングリコールビス (β –

エピチオプロピルチオプロピオネート)、ジエチレング リコールビス(β-エピチオプロピルチオアセテー ト)、ジエチレングリコールビス(β-エピチオプロピ ルチオプロピオネート)、1,4-シクロヘキサンジオ ールビス (βーエピチオプロピルチオアセテート)、 1, 4-シクロヘキサンジオールビス (β-エピチオプ ロピルチオプロピオネート)、トリメチロールプロパン ビス (β-エピチオプロピルチオアセテート)、トリメ チロールプロパンビス(β-エピチオプロピルチオプロ ピオネート)、トリメチロールプロパントリス(β-エ ピチオプロピルチオアセテート)、トリメチロールプロ パントリス (β-エピチオプロピルチオプロピオネー ト)、ペンタエリスリトールビス(β-エピチオプロピ ルチオアセテート)、ペンタエリスリトールピス (βー エピチオプロピルチオプロピオネート)、ペンタエリス リトールトリス(β-エピチオプロピルチオアセテー ト)、ペンタエリスリトールトリス(β-エピチオプロ ピルチオプロピオネート)、ペンタエリスリトールテト ラキス (β-エピチオプロピルチオアセテート)、ペン タエリスリトールテトラキス (β-エピチオプロピルチ オプロピオネート)、2,5-ヒドロキシメチルー1, 4-ジチアンビス (β-エピチオプロピルチオアセテー

ト)、2、5ーヒドロキシメチルー1、4ージチアンビ ス (β-エピチオプロピルチオプロピオネート)、カテ コールビス (β-エピチオプロピルチオアセテート)、 カテコールビス(βーエピチオプロピルチオプロピオネ ート)、レゾルシノールビス(β-エピチオプロピルチ オアセテート)、レゾルシノールビス(β-エピチオプ ロピルチオプロピオネート)、ハイドロキノンビス(B ーエピチオプロピルチオアセテート)、ハイドロキノン $ilde{U}$ ス(β -エピチオプロピルチオプロピオネート)、2 $-(\beta-x \theta + x \theta - x \theta + x \theta$ ピチオプロピルチオエチル) エステル、2-(B-エピ チオプロピルチオ) コハク酸ビス (β-エピチオプロピ ルチオエチル) エステル、2 - (β-エピチオプロピル チオ) グルタル酸ビス (β-エピチオプロピルチオエチ ル) エステル、3 ー (β - エピチオプロピルチオ) グル タル酸ビス (β-エピチオプロピルチオエチル) エステ ル、2-(β-エピチオプロピルチオ) アジピン酸ビス $(\beta - x + 2 + x + 2$ (β-エピチオプロピルチオ) アジピン酸ビス (β-エ ピチオプロピルチオエチル)エステル、2,3-ビス $(\beta - x \theta + x \theta - x \theta + x \theta$ チオプロピルチオエチル) エステル、2, 3-ビス (B -エピチオプロピルチオ) グルタル酸ビス (β-エピチ オプロピルチオエチル) エステル、2, $4-ビス(\beta-$ エピチオプロピルチオ) グルタル酸ビス (β -エピチオ プロピルチオエチル)エステル、2, $3-ビス(\beta-x)$ ピチオプロピルチオ) アジピン酸ビス (β-エピチオプ ロピルチオエチル) エステル、2, 4-ビス (β-エピ チオプロピルチオ) アジピン酸ビス (B-エピチオプロ ピルチオエチル) エステル、2, 5ービス (β-エピチ 30 オプロピルチオ) アジピン酸ビス (β-エピチオプロピ ルチオエチル) エステル、3, 4ービス (β-エピチオ プロピルチオ) アジピン酸ビス (β-エピチオプロピル チオエチル) エステル、3ーチアペンタンー1, 5ージ カルボン酸ビス (β-エピチオプロピルチオエチル) エ ステル、3, 4 ージチアヘキサンー1, 6 ージカルボン 酸ビス (β-エピチオプロピルチオエチル) エステル、 3, 5-ジチアヘプタン-1, 7-ジカルボン酸ビス (β−エピチオプロピルチオエチル)エステル、4− (β-エピチオプロピルチオエチルカルボキシメチルチ 40 オ) -3, 5-ジチアヘプタン-1, 7-ジカルボン酸 ビス (β-エピチオプロピルチオエチル) エステル等が 挙げられる。

【0012】本発明の、新規なエピスルフィド化合物は、メルカプト基を有する硫黄化合物(硫化水素を含む)またはこれらの金属塩等と、エピクロルヒドリン、アルキルエピクロロヒドリンに代表されるエピハロヒドリンまたはアルキルエピハロヒドリンとをアルカリ存在下で反応させて、(1)式でXがOであるエポキシ構造を有する化合物を得、ついで、該エポキシ化合物を、チ 50

オシアン酸塩、チオ尿素、トリフェニルホスフィンスル フィド、3ーメチルベンゾチアゾールー2ーチオン等の チア化剤と、好ましくはチオシアン酸塩、チオ尿素と反 応させ製造される。アルキルエピハロヒドリン化合物は 使用する硫黄化合物の2倍モルを使用するが、生成物の 純度、反応速度、経済性等を重視するのであれば、これ 以下でもこれ以上の量を使用してもかまわない。好まし くは2~5倍モル使用し反応する。より好ましくは2~ 3倍モルを使用し反応する。反応は、無溶媒あるいは溶 媒中のいずれでもかまわないが、溶媒を使用するとき は、アルキルエピハロヒドリンあるいは硫黄化合物のい ずれかが可溶のものを使用することが望ましい。具体例 としては、水、アルコール類、エーテル類、芳香族炭化 水素類、ハロゲン化炭化水素類等があげられる。反応は 量論以上の塩基の存在下において容易に進行する。塩基 としては、ピリジン、トリエチルアミン、ジアザビシク ロウンデセン等の三級アミン、アルカリまたはアルカリ 土類金属の水酸化物等があげられるが、好ましいもの は、アルカリまたはアルカリ土類金属の水酸化物であ り、より好ましいものは、水酸化ナトリウム、水酸化カ リウム等である。また、この反応において、テトラブチ ルアンモニウムブロミド等の相関移動触媒を用いてもか まわない。反応温度は通常0~100℃で実施される が、好ましくは0~60℃である。反応時間は上記の各 種条件下で反応が完結する時間であればかまわないが、 通常10時間以下が適当である。

【0013】(1)式のXがOであるエポキシ化合物よ り本発明の新規なエピスルフィド化合物を製造する方法 において、チア化剤としてチオシアン酸塩を使用する場 合、好ましいチオシアン酸塩は、アルカリまたはアルカ リ土類金属の塩であり、より好ましいものは、チオシア ン酸カリウム、チオシアン酸ナトリウム、チオシアン酸 アンモニウムである。また、チア化剤であるチオシアン 酸塩、チオ尿素は量論的にはエポキシ化合物のエポキシ 基数に対応するモル数を使用するが、生成物の純度、反 応速度、経済性等を重視するのであれば、これ以下でも これ以上の量を使用してもかまわない。好ましくは量論 ~ 量論の5倍モル使用し反応する。より好ましくは量論 ~量論の2. 5倍モルを使用し反応する。反応は、無溶 媒あるいは溶媒中のいずれでもかまわないが、溶媒を使 用するときは、チオシアン酸塩あるいはチオ尿素さらに はエポキシ化合物いずれかが可溶のものを使用すること が望ましい。具体例としては、水、メタノール、エタノ ール等のアルコール類;ジエチルエーテル、テトラヒド ロフラン、ジオキサン等のエーテル類;メチルセルソル プ、エチルセルソルブ、プチルセルソルブ等のヒドロキ シエーテル類:ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香 族炭化水素類;ジクロロエタン、クロロホルム、クロロ ベンゼン等のハロゲン化炭化水素類等があげられ、これ らの併用使用、例えば、アルコール類と水の組み合わ

せ、エーテル類、ヒドロキシエーテル類、ハロゲン化炭 化水素類、芳香族炭化水素類とアルコール類の組み合わ せ等は効果的な場合がある。また、反応液中に酸および 酸無水物等を重合抑制剤として添加することは、反応成 **續を上げる面から有効な手段である。酸および酸無水物** 等の具体例としては、硝酸、塩酸、硫酸、発煙硫酸、ホ ウ酸、ヒ酸、燐酸、青酸、酢酸、過酢酸、チオ酢酸、蓚 酸、酒石酸、プロピオン酸、酪酸、コハク酸、マレイン 酸、安息香酸、無水硝酸、無水硫酸、酸化ホウ素、五酸 化ヒ酸、五酸化燐、無水クロム酸、無水酢酸、無水プロ ピオン酸、無水酪酸、無水コハク酸、無水マレイン酸、 無水安息香酸、無水フタル酸、シリカゲル、シリカアル ミナ、塩化アルミニウム等があげられ、これらのいくつ かを併用することも可能である。添加量は通常反応液総 量に対して0.001~10wt%の範囲で用いられる が、好ましくは 0. 01~1wt%である。反応温度は 通常0~100℃で実施されるが、好ましくは20~7 0℃である。反応時間は上記の各種条件下で反応が完結

$$R^{2} R^{1}$$
 $| |$
 $R^{3} - C = C - R^{4} - S -$

(ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ炭素数 $1\sim 10$ の炭化水素基または水素を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 の少なくとも 1 つは水素ではない。 R^4 は炭素数 $0\sim 10$ の炭化水素鎖を表す。)

【0015】さらに、別法としては(1)式において(4)式で表される構造を有するハロメルカプタン化合物より脱ハロゲン化水素反応により製造することも有力な方法である。

[(£12]

$$R^{2}R^{1}$$

 $| | |$
 $R^{3}-C-C-R^{4}-S-$
 $| | |$
 $Z SH$ (5)

(ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 はそれぞれ炭素数 $1\sim 10$ の炭化水素基または水素を表し、 R^1 、 R^2 、 R^3 の少なくとも 1 つは水素ではない。 R^4 は炭素数 $0\sim 10$ の 40 炭化水素鎖を表す。 Z は塩素あるいは臭素原子を表す。)

ハロメルカプタンは、上述の(5)式で表される不飽和化合物と例えば塩化イオウ類から、容易に合成できることが知られている(例えば、F. Lautenschlaergerら、J. Org. Chem., 34, 39 6 (1969))。

【0016】本発明のエピスルフィド化合物は、硬化触媒の存在下あるいは不存在下に、加熱重合し樹脂を製造することができる。好ましい方法は硬化触媒を使用する 50

する時間であればかまわないが通常20時間以下が適当である。反応生成物は酸性水溶液を用いた洗浄によって、得られる化合物を安定性を向上せしめることが可能である。酸性水溶液に用いる酸の具体例としては、硝酸、塩酸、硫酸、ホウ酸、ヒ酸、燐酸、青酸、酢酸、過酢酸、チオ酢酸、蓚酸、酒石酸、コハク酸、マレイン酸等があげられる。また、これらは単独でも2種類以上を混合して用いても良い。これらの酸の水溶液は通常pH6以下で効果を現すが、より効果的な範囲はpH3以下である。

【0014】以上とは別の製法として、上記(1)式の XがOであるエポキシ化合物を、対応する下記(4)式 で表される不飽和化合物を有機過酸、アルキルヒドロペ ルオキサイド、過酸化水素等による酸化により製造しこれを上述の方法により上記(1)式のエピスルフィド化 合物とする方法も挙げられる。

【化11】

(4)

方法であり、硬化触媒はアミン類、フォスフィン類、鉱 酸類、ルイス酸類、有機酸類、ケイ酸類、四フッ化ホウ 酸等が使用される。具体例としては、

(1) エチルアミン、n-プロピルアミン、sec-プ ロピルアミン、nーブチルアミン、secーブチルアミ ン、iーブチルアミン、tertーブチルアミン、ペン チルアミン、ヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチ ルアミン、デシルアミン、ラウリルアミン、ミスチリル アミン、1,2ージメチルヘキシルアミン、3ーペンチ ルアミン、2ーエチルヘキシルアミン、アリルアミン、 アミノエタノール、1-アミノプロパノール、2-アミ ノプロパノール、アミノブタノール、アミノペンタノー ル、アミノヘキサノール、3-エトキシプロピルアミ ン、3ープロポキシプロピルアミン、3ーイソプロポキ シプロピルアミン、3ーブトキシプロピルアミン、3ー イソプトキシプロピルアミン、3-(2-エチルヘキシ ロキシ)プロピルアミン、アミノシクロペンタン、アミ ノシクロヘキサン、アミノノルボルネン、アミノメチル シクロヘキサン、アミノベンゼン、ベンジルアミン、フ ェネチルアミン、αーフェニルエチルアミン、ナフチル アミン、フルフリルアミン等の1級アミン;エチレンジ アミン、1, 2-ジアミノプロパン、1, 3-ジアミノ プロパン、1,2-ジアミノブタン、1.3-ジアミノ ブタン、1, 4ージアミノブタン、1, 5ージアミノペ ンタン、1,6-ジアミノヘキサン、1,7-ジアミノ ヘプタン、1,8ージアミノオクタン、ジメチルアミノ プロピルアミン、ジエチルアミノプロピルアミン、ビス (3-アミノプロピル) エーテル、1, 2-ビス (3-

アミノプロポキシ)エタン、1,3-ビス(3-アミノ プロポキシ)-2,2'-ジメチルプロパン、アミノエ チルエタノールアミン、1,2-、1,3-あるいは 1. 4ービスアミノシクロヘキサン、1,3ーあるいは 1, 4ービスアミノメチルシクロヘキサン、1, 3ーあ るいは1, 4ービスアミノエチルシクロヘキサン、1, 3-あるいは1, 4-ビスアミノプロピルシクロヘキサ ン、水添4, 4'ージアミノジフェニルメタン、2ーあ るいは4-アミノピペリジン、2-あるいは4-アミノ メチルピペリジン、2-あるいは4-アミノエチルピペ リジン、Nーアミノエチルピペリジン、Nーアミノプロ ピルピペリジン、N-アミノエチルモルホリン、N-ア ミノプロピルモルホリン、イソホロンジアミン、メンタ ンジアミン、1, 4ービスアミノプロピルピペラジン、 oー、mー、あるいはpーフェニレンジアミン、2, 4 ーあるいは2,6ートリレンジアミン、2,4ートルエ ンジアミン、m-アミノベンジルアミン、4-クロロー o-フェニレンジアミン、テトラクロロ-p-キシリレ ンジアミン、4ーメトキシー6ーメチルーmーフェニレ ンジアミン、mー、あるいはpーキシリレンジアミン、 1, 5-あるいは、2, 6-ナフタレンジアミン、ベン ジジン、4, 4'ービス(oートルイジン)、ジアニシ ジン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、2,2-(4, 4'ージアミノジフェニル)プロパン、4, 4' ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ーチオジアニ リン、4,4'ージアミノジフェニルスルホン、4, 4'ージアミノジトリルスルホン、メチレンピス(o-クロロアニリン)、3,9-ビス(3-アミノプロピ ル) 2, 4, 8, 10ーテトラオキサスピロ [5, 5] ウンデカン、ジエチレントリアミン、イミノビスプロピ 30 ルアミン、メチルイミノビスプロピルアミン、ビス(へ キサメチレン) トリアミン、トリエチレンテトラミン、 テトラエチレンペンタミン、ペンタエチレンヘキサミ ン、Nーアミノエチルピペラジン、Nーアミノプロピル ピペラジン、1, 4ービス(アミノエチルピペラジ ン)、1,4-ビス(アミノプロピルピペラジン)、 2, 6ージアミノピリジン、ビス(3, 4ージアミノフ ェニル)スルホン等の1級ポリアミン;ジエチルアミ ン、ジプロピルアミン、ジーnーブチルアミン、ジーs e c ープチルアミン、ジイソプチルアミン、ジーn ーペ 40 ンチルアミン、ジー3ーペンチルアミン、ジヘキシルア ミン、オクチルアミン、ジ(2-エチルヘキシル)アミ ン、メチルヘキシルアミン、ジアリルアミン、ピロリジ ン、ピペリジン、2-、3-、4-ピコリン、2,4 -、2,6-、3,5-ルペチジン、ジフェニルアミ ン、Nーメチルアニリン、Nーエチルアニリン、ジベン ジルアミン、メチルベンジルアミン、ジナフチルアミ ン、ピロール、インドリン、インドール、モルホリン等 の2級アミン; N, N'ージメチルエチレンジアミン、 $N, N' - \vec{y} \times \vec{y} + N - 1, 2 - \vec{y} = 2$

N'ージメチルー1, 3-ジアミノプロパン、N. N' ージメチルー1, 2 ージアミノブタン、N, N' ージメ チルー1, 3-ジアミノブタン、N, N' -ジメチルー 1, 4 - ジアミノブタン、N, N' - ジメチルー1, 5 ージアミノペンタン、N, N'ージメチルー1, 6ージ アミノヘキサン、N, N' -ジメチル-1, 7-ジアミ ノヘプタン、N, N'ージエチルエチレンジアミン、 N, N' ージエチルー1, 2ージアミノプロパン、N, N'ージエチルー1, 3ージアミノプロパン、N, N' ージエチルー1, 2 ージアミノブタン、N, N' ージエ チルー1, 3-ジアミノブタン、N, N' -ジエチルー 1, 4-ジアミノブタン、N, N' -ジエチルー1, 6 ージアミノヘキサン、ピペラジン、2ーメチルピペラジ ン、2,5-あるいは2,6-ジメチルピペラジン、ホ モピペラジン、1, 1-ジー(4-ピペリジル)メタ ン、1、2-ジー(4-ピペリジル)エタン、1、3-ジー(4-ピペリジル)プロパン、1,4-ジー(4-ピペリジル) ブタン、テトラメチルグアニジン等の2級 ポリアミン: トリメチルアミン、トリエチルアミン、ト リーnープロピルアミン、トリーisoープロピルアミ ン、トリー1、2ージメチルプロピルアミン、トリー3 ーメトキシプロピルアミン、トリーnープチルアミン、 トリーisoーブチルアミン、トリーsecーブチルア ミン、トリーペンチルアミン、トリー3ーペンチルアミ ン、トリーnーヘキシルアミン、トリーnーオクチルア ミン、トリー2ーエチルヘキシルアミン、トリードデシ ルアミン、トリーラウリルアミン、ジシクロヘキシルエ チルアミン、シクロヘキシルジエチルアミン、トリーシ クロヘキシルアミン、N, Nージメチルヘキシルアミ ン、Nーメチルジヘキシルアミン、N, Nージメチルシ クロヘキシルアミン、Nーメチルジシクロヘキシルアミ ン、N、Nージエチルエタノールアミン、N、Nージメ チルエタノールアミン、Nーエチルジエタノールアミ ン、トリエタノールアミン、トリベンジルアミン、N. Nージメチルベンジルアミン、ジエチルベンジルアミ ン、トリフェニルアミン、N, Nージメチルアミノーp ークレゾール、N,Nージメチルアミノメチルフェノー ル、2-(N, N-ジメチルアミノメチル)フェノー ル、N, Nージメチルアニリン、N, Nージエチルアニ リン、ピリジン、キノリン、Nーメチルモルホリン、N ーメチルピペリジン、2-(2-ジメチルアミノエトキ シ) -4-メチル-1,3,2-ジオキサボルナン等の 3級アミン;テトラメチルエチレンジアミン、ピラジ ン、N, N'ージメチルピペラジン、N, N'ービス ((2-ヒドロキシ)プロピル)ピペラジン、ヘキサメ チレンテトラミン、N, N, N', N'ーテトラメチル -1, 3-プタンアミン、2-ジメチルアミノ-2-ヒ ドロキシプロパン、ジエチルアミノエタノール、N, N, N-トリス (3-ジメチルアミノプロピル) アミ ン、2, 4, 6-トリス (N, N-ジメチルアミノメチ

ノミガガ.... 1.絽 つ

ル) フェノール、ヘプタメチルイソビグアニド等の3級 ポリアミン;イミダゾール、N-メチルイミダゾール、 2-メチルイミダゾール、4-メチルイミダゾール、、 N-エチルイミダゾール、2-エチルイミダゾール、4 ーエチルイミダゾール、N ープチルイミダゾール、2 ー ブチルイミダゾール、N-ウンデシルイミダゾール、2 ーウンデシルイミダゾール、Nーフェニルイミダゾー ル、2-フェニルイミダゾール、N-ベンジルイミダゾ ール、2ーベンジルイミダゾール、1ーベンジルー2ー メチルイミダゾール、N-(2'-シアノエチル)-2 ーメチルイミダゾール、N ー (2'ーシアノエチル) ー 2-ウンデシルイミダゾール、N-(2'-シアノエチ ル) -2-フェニルイミダゾール、3,3-ビス-(2) ーエチルー4ーメチルイミダゾリル)メタン、アルキル イミダゾールとイソシアヌール酸の付加物、アルキルイ ミダゾールとホルムアルデヒドの縮合物等の各種イミダ ゾール類;1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウン デセンー7、1,5ージアザビシクロ(4,3,0)ノ ネン-5、6-ジプチルアミノ-1,8-ジアザビシク ロ(5, 4, 0) ウンデセンー7等のアミジン類;以上 20 に代表されるアミン系化合物。

(2)上記(1)のアミン類とハロゲン、鉱酸、ルイス酸、有機酸、ケイ酸、四フッ化ホウ酸等との4級アンモニウム塩。

(3)上記(1)のアミン類とボランおよび三フッ化ホウ素とのコンプレックス。

(4) トリメチルフォスフィン、トリエチルフォスフィン、トリーiso一プロピルフォスフィン、トリーnープチルフォスフィン、トリーnーペキシルフォスフィン、トリーnーオクチルフォスフィン、トリシクロペキシルホスフィン、トリフェニルフォスフィン、トリベンジルホスフィン、トリス(2ーメチルフェニル)ホスフィン、トリス(3ーメチルフェニル)ホスフィン、トリス(ジェチルアミノ)ホスフィン、トリス(4ーメチルフェニル)ホスフィン、ジメチルフェニルフォスフィン、ジェチルフェニルフォスフィン、ジェチルフェニルフォスフィン、ジェチルフェニルフォスフィン、ジフェニルシクロペキシルホスフィン、グロロジフェニルフォスフィン等のフォスフィン類。

(5)塩酸、硫酸、硝酸、燐酸、炭酸等の鉱酸類および これらの半エステル類。

(6) 3フッ化硼素、3フッ化硼素のエーテラート等に 代表されるルイス酸類。

(7) 有機酸類およびこれらの半エステル類

(8) ケイ酸、四フッ化ホウ酸。

(9) ジプチルスズジラウレート、ジプチルスズジクロリドおよびトリプチルスズクロリド等のスズ化合物。 等である。これらのなかで硬化物の着色が少なく好ましいものは、1級モノアミン、2級モノアミン、3級モノ 50

アミン、3級ポリアミン、イミダゾール類、アミジン 類、4級アンモニウム塩、フォスフィン、スズ化合物で あり、より好ましいものは、エピスルフィド基と反応し 得る基を1個以下有する化合物である、2級モノアミ ン、3級モノアミン、3級ポリアミン、イミダゾール 類、アミジン類、4級アンモニウム塩、フォスフィン類 である。また、これらは単独でも2種類以上を混合して 用いても良い。以上の硬化触媒は、(1)式で表される 構造を1分子中に1個以上有する化合物1モルに対して 通常0.0001モルから1.0モル使用するが、好ま しくは、0.0001モルから0.5モル、より好まし くは、0.0001モルから0.1モル未満、最も好ま しくは、0.001モルから0.05モル使用する。 硬化触媒の量がこれより多いと硬化物の屈折率、耐熱性 が低下し、また着色する。これより少ないと十分に硬化 せず耐熱性が不十分となる。

22

【0017】本発明において重合硬化した材料にさらに 耐酸化性を付与せしめるために、坑酸化成分としてSH‐ 基1個以上有する化合物を単独もしくは公知の酸化防止 剤と併用して使用することも可能である。上述のSH基 を1個以上有する化合物を、以下により具体的に示す。 メチルメルカプタン、エチルメルカプタン、nープロピ ルメルカプタン、nーブチルメルカプタン、アリルメル カプタン、nーヘキシルメルカプタン、nーオクチルメ ルカプタン、nーデシルメルカプタン、nードデシルメ ルカプタン、nーテトラデシルメルカプタン、nーへキ サデシルメルカプタン、nーオクタデシルメルカプタ ン、シクロヘキシルメルカプタン、イソプロピルメルカ プタン、tertーブチルメルカプタン、tertーノ ニルメルカプタン、tertードデシルメルカプタン、 ベンジルメルカプタン、4-クロロベンジルメルカプタ ン、メチルチオグリコーレート、エチルチオグリコーレ ート、nープチルチオグリコーレート、nーオクチルチ オグリコーレート、メチル(3-メルカプトプロピオネ ート)、エチル(3ーメルカプトプロピオネト)、3ー メトキシブチル(3-メルカプトプロピオネート)、n ーブチル(3ーメルカプトプロピオネート)、2ーエチ ルヘキシル(3-エルカプトプロピオネート)、n-オ クチル(3-メルカプトプロピオネート)、2-メルカ プトエタノール、3ーメルカプトプロパノール、2ーメ ルカプトプロパノール、2-ヒドロキシプロピルメルカ プタン、2-フェニルー2-メルカプトエタノール、2 ーフェニルー2ーヒドロキシエチルメルカプタン、3ー メルカプトー1,2ープロパンジオール、2ーメルカプ トー1、3ープロパンジオール等のモノメルカプタン 類;メタンジチオール、1,2-ジメルカプトエタン、 1, 2ージメルカプトプロパン、2, 2ージメルカプト プロパン、1,3-ジメルカプトプロパン、1,2,3 ートリメルカプトプロパン、1, 4ージメルカプトブタ ン、1,6-ジメルカプトヘキサン、ビス(2-メルカ

プトエチル)スルフィド、1,2-ビス(2-メルカプ トエチルチオ) エタン、1,5-ジメルカプト-3-オ キサペンタン、1,8-ジメルカプト-3,6-ジオキ サオクタン、2, 2ージメチルプロパン-1, 3ージチ オール、3, 4ージメトキシブタン-1, 2ージチオー ル、2-メルカプトメチル-1、3-ジメルカプトプロ パン、2-メルカプトメチル-1, 4-ジメルカプトブ タン、2-(2-メルカプトエチルチオ)-1,3-ジ メルカプトプロパン、1,2-ビス(2-メルカプトエ チルチオ) -3-メルカプトプロパン、1,1,1-ト リス (メルカプトメチル) プロパン、テトラキス (メル カプトメチル)メタン、エチレングリコールビス(2-メルカプトアセテート)、エチレングリコールビス(3 ーメルカプトプロピオネート)、1,4-ブタンジオー ルビス(2ーメルカプトアセテート)、1,4ープタン ジオールビス (3-メルカプトプロピオネート)、トリ メチロールプロパントリス(2-メルカプトアセテー ト)、トリメチロールプロパントリス(3-メルカプト プロピオネート)、ペンタエリスリトールテトラキス (2-メルカプトセテート)、ペンタエリスリトールテ トラキス(3-メルカプトプロピオネート)、1,1-ジメルカプトシクロヘキサン、1,4-ジメルカプトシ クロヘキサン、1,3-ジメルカプトシクロヘキサン、 1, 2ージメルカプトシクロヘキサン、1, 4ービス (メルカプトメチル) シクロヘキサン、1,3-ビス (メルカプトメチル)シクロヘキサン、2,5-ビス (メルカプトメチル) -1, 4-ジチアン、2, 5-ビ ス(2-メルカプトエチル)-1,4-ジチアン、2,5ービス(メルカプトメチル)-1ーチアン、2、5-ビス(2ーメルカプトエチル)-1-チアン、1,4-ビス (メルカプトメチル) ベンゼン、1,3-ビス (メ ルカプトメチル) ベンゼン、ビス (4ーメルカプトフェ ニル)スルフィド、ビス(4ーメルカプトフェニル)エ ーテル、2, 2ービス(4ーメルカプトフェニル)プロ パン、ビス(4ーメルカプトメチルフェニル)スルフィ ド、ビス(4ーメルカプトメチルフェニル)エーテル、 2, 2-ビス(4-メルカプトメチルフェニル)プロパ ン、2、5ージメルカプトー1、3、4ーチアジアゾー ル、3、4ーチオフェンジチオール、1、2ージメルカ プトー3ープロパノール、1,3ージメルカプトー2ー プロパノール、グリセリルジチオグリコーレート等のポ リメルカプタン類;チオフェノール、4-tertープ チルチオフェノール、2ーメチルチオフェノール、3ー メチルチオフェノール、4-メチルチオフェノール、 1, 2-ジメルカプトベンゼン、1, 3-ジメルカプト ベンゼン、1, 4ージメルカプトベンゼン、2ーヒドロ キシチオフェノール、3ーヒドロキシチオフェノール、 4ーヒドロキシチオフェノール等のチオフェノール類: アリルメルカプタン、2-ビニルベンジルメルカプタ ン、3ービニルベンジルメルカプタン、4ービニルベン 50

ジルメルカプタン等の不飽和基を有するメルカプタン類;としては、2-ビニルチオフェノール、3-ビニルチオフェノール、4-ビニルチオフェノール等の不飽和基を有するチオフェノール類をあげることができる。これらは、単独でも、2種類以上を混合して使用してもかまわず、本発明の化合物100重量部に対して0.001~40重量部使用可能である。

【0018】本発明の化合物は単独で十分良好な染色性 を有するが、さらに染色性を向上せしめるために、染色 性向上成分として、カルボン酸、メルカプトカルボン 酸、ヒドロキシカルボン酸、アミド、1,3-ジケト ン、1,3-ジカルボン酸、3-ケトカルボン酸および そのエステル類、不飽和基を有する化合物と併用して使 用することも可能である。より具体的には、カルボン酸 類としては、蟻酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草 酸、カプロン酸、カプリル酸、メチルメルカプトプロピ オネート、蓚酸、マロン酸、琥珀酸、グルタル酸、アジ ピン酸、シクロヘキサンカルボン酸、安息香酸、oート ルイル酸、mートルイル酸、pートルイル酸、2ーメト キシ安息香酸、3ーメトキシ安息香酸、フタル酸、イソ フタル酸、テレフタル酸、チオジプロピオン酸、ジチオ ジプロピオン酸等をあげることができる。メルカプトカ ルボン酸類としては、チオグリコール酸、2-チオプロ ピオン酸、3ーチオプロピオン酸、チオ乳酸、メルカプ トコハク酸、チオリンゴ酸、N-(2-メルカプトプロ ピオニル) グリシン、2-メルカプト安息香酸、2-メ ルカプトニコチン酸、3,3-ジチオイソ酪酸、ジチオ グリコール酸、ジチオプロピオン酸等をあげることがで きる。ヒドロキシカルボン酸類としては、ヒドロキシ酢 酸、 α ーヒドロキシプロピオン酸、 β ーヒドロキシプロ ピオン酸、 α ーヒドロキシ酪酸、 β ーヒドロキシ酢酸、 y-ヒドロキシ酪酸、サリチル酸、3-ヒドロキシ安息 香酸、4ーヒドロキシ安息香酸等があげられる。アミド 類としては、ホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、 アセトアミド、Nーメチルアセトアミド、フタルアミ ド、イソフタルアミド、テレフタルアミド、ベンズアミ ド、トルアミド、4ーヒドロキシベンズアミド、3ーヒ ドロキシベンズアミド等をあげることができる。1,3 ージケトン類としては、アセチルアセトン、シクロヘキ サンー1, 3, 5ートリオン等があげられる。1, 3-ジカルボン酸およびそのエステル類としては、マロン 酸、2-メチルマロン酸等およびそれらのモノ、ジェス テル類があげられる。3-ケトカルボン酸およびそのエ ステル類としては、アセト酢酸およびそのエステル類等 があげられる。また、不飽和基を有する化合物として、 アルコール類、フェノール類、メルカプタン類、チオフ ェノール類、メルカプトアルコール類、カルボン酸類、 アミド類を以下に具体的に示す。不飽和基を有するアル コール類としては、2-ヒドロキシエチルメタクリレー ト、2ーヒドロキシエチルアクリレート、3ーヒドロキ

シプロピルメタクリレート、3ーヒドロキシプロピルア クリレート、2ーヒドロキシプロピルメタクリレート、 2ーヒドロキシプロピルアクリレート、1,3ージメタ クリロキシー2ープロパノール、1,3ージアクリロキ シー2ープロパノール、1ーアクリロキシー3ーメタク リロキシー2ープロパノール、ペンタエリスリトールト リメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレ ート、ビス(2,2,2ートリメチロールエチル)エー テルのペンタメタクリレート、ビス(2, 2, 2-トリ メチロールエチル) エーテルのペンタアクリレート、ト リメチロールプロパンジメタクリレート、トリメチロー ルプロパンジアクリレート、アリルアルコール、クロチ ルアルコール、メチルビニルカルビノール、シンナミル アルコール、4ービニルベンジルアルコール、3ービニ ルベンジルアルコール、2-(4-ビニルベンジルチ オ) エタノール、2-(3-ビニルベンジルチオ) エタ ノール、1,3-ビス(4-ビニルベンジルチオ)-2 ープロパノール、1,3ービス(3ービニルベンジルチ オ) -2-プロパノール、2,3-ビス(4-ビニルベ ンジルチオ) -1-プロパノール、2,3-ビス(3-20 ビニルベンジルチオ) -1-プロパノール、3-フェノ キシー2-ヒドロキシプロピルアクリレート、2-ヒド ロキシエチルイソシアヌレートピス(アクリレート)、 2ーヒドロキシエチルイソシアヌレートピス (メタクリ レート)、2-ヒドロキシエチルシアヌレートビス(ア クリレート)、2ーヒドロキシエチルシアヌレートビス (メタクリレート)、3-メチル-1-ブチン-3-オ ール、3-メチル-1-ペンチン-3オール、プロパギ ルアルコール等のモノヒドロキシ化合物;ペンタエリス リトールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジア クリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレー ト、ペンタエリスリトールモノアクリレート、トリメチ ロールプロパンモノメタクリレート、トリメチロールプ ロパンモノアクリレート、2ーヒドロキシエチルイソシ アヌレートモノ (アクリレート)、2-ヒドロキシエチ ルイソシアヌレートモノ(メタクリレート)、2ーヒド ロキシエチルシアヌレートモノ (アクリレート)、2-ヒドロキシエチルシアヌレートモノ(メタクリレー ト)、等のポリヒドロキシ化合物、また、2、2-ビス [4-(2-ヒドロキシー3-メタクリロキシプロポキ 40 シ)フェニル)プロパン等の後述するエポキシ化合物と アクリル酸またはメタクリル酸の付加反応で生成する不 飽和ポリヒドロキシ化合物等をあげることができる。不 飽和基を有するフェノール類としては、2-ビニルフェ **ノール、3ービニルフェノール、4ービニルフェノール** 等をあげることができる。不飽和基を有すメルカプトア ルコール類としては、2-(4-ビニルベンジルチオ) -2-メルカプトエタノール、2-(3-ビニルベンジ ルチオ) -2-メルカプトエタノール、等をあげること ができる。不飽和基を有するカルボン酸類としては、ア

クリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、フタル酸モノヒドロキシエチルアクリレート、マレイン酸、フマル酸、フタル酸モノアリルエステル、ケイ皮酸等をあげることができる。不飽和基を有するアミド類としては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸等の α 、 β —不飽和カルボン酸類のアミド、Nービニルホルムアミド等をあげることができる。耐熱性の観点から、好ましい化合物はメルカプトアルコール類、ヒドロキシチオフェノール類、不飽和基を有するアルコール類である。これらは、単独でも、2種類以上を混合して使用してもかまわず、本発明の化合物100重量部に対して0.001~40重量部使用可能である。

【0019】また、本発明のエピスルフィド化合物は前 述の坑酸化成分と染色性向上成分の他に、ポリエピスル フィド中のエピスルフィド基および/またはエポキシ基 と反応可能な官能基を2個以上有する化合物、あるい は、これらの官能基1個以上と他の単独重合可能な官能 基を1個以上有する化合物、これらの単独重合可能な官 能基を1個以上有する化合物、さらには、エピスルフィ ド基および/またはエポキシ基と反応可能でかつ単独重 合も可能な官能基を1個有する化合物と硬化重合して製 造することもできる。ポリエピスルフィド中のエピスル フィド基および/またはエポキシ基と反応可能な官能基 を2個以上有する化合物としては、エポキシ化合物、公 知のエピスルフィド化合物、多価カルボン酸無水物等が あげられる。一方、エピスルフィド基および/またはエ ポキシ基と反応可能な官能基1個以上と他の単独重合可 能な官能基を1個以上有する化合物としては、メタクリ ル、アクリル、アリル、ビニル、芳香族ビニル等の不飽 和基を有するエポキシ化合物、エピスルフィド化合物、 カルボン酸無水物等があげられる。単独重合可能な官能 基を1個以上有する化合物としては、メタクリル、アク リル、アリル、ビニル、芳香族ビニル等の不飽和基を有 する化合物があげられる。以下にエピスルフィド基と反 応可能な官能基を2個以上有する化合物の具体例を示 す。

【0020】エポキシ化合物の具体例としては、ヒドロキノン、カテコール、レゾルシン、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールスルフォン、ビスフェノールスルフィド、ビスフェノールスルフィド、ビスフェノールスルフィド、ビスフェノールスルフィド、バスフェノールスルフィド、ハロゲン化ビスフェノールA、ノボラック樹脂等の多価フェノール化合物とエピハロヒドリンの縮合により製造されるフェノール系エポキシ化合物:エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ジプロパンジオール、1、4ーブタンジオール、1、6ーへキサンジオール、ネオペンチルグリコール、グリセリン、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトール、1、3ー

および1、4-シクロヘキサンジオール、1、3-およ び1、4-シクロヘキサンジメタノール、水添ピスフェ ノールA、ピスフェノールA・エチレンオキサイド付加 物、ビスフェノールA・プロピレンオキサイド付加物等 の多価アルコール化合物とエピハロヒドリンの縮合によ り製造されるアルコール系エポキシ化合物;アジピン 酸、セバチン酸、ドデカンジカルボン酸、ダイマー酸、 フタル酸、イソ、テレフタル酸、テトラヒドロフタル 酸、メチルテトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル 酸、ヘキサヒドロイソフタル酸、ヘキサヒドロテレフタ ル酸、ヘット酸、ナジック酸、マレイン酸、コハク酸、 フマール酸、トリメリット酸、ベンゼンテトラカルボン 酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸、ナフタリンジカ ルボン酸、ジフェニルジカルボン酸等の多価カルボン酸 化合物とエピハロヒドリンの縮合により製造されるグリ シジルエステル系エポキシ化合物;エチレンジアミン、 1, 2ージアミノプロパン、1, 3ージアミノプロパ ン、1,2-ジアミノブタン、1,3-ジアミノブタ ン、1、4-ジアミノブタン、1、5-ジアミノペンタ ン、1,6-ジアミノヘキサン、1,7-ジアミノヘプ 20 タン、1,8-ジアミノオクタン、ビスー(3-アミノ プロピル)エーテル、1,2-ビス-(3-アミノプロ ポキシ) エタン、1, 3-ビス-(3-アミノプロポキ シ) -2, 2' -ジメチルプロパン、1, 2-、1, 3 ーあるいは1, 4ービスアミノシクロヘキサン、1, 3 -あるいは1,4-ビスアミノメチルシクロヘキサン、 1, 3-あるいは1, 4-ビスアミノエチルシクロヘキ サン、1,3-あるいは1,4-ビスアミノプロピルシ クロヘキサン、水添4,4'ージアミノジフェニルメタ ン、イソホロンジアミン、1,4-ビスアミノプロピル 30 ピペラジン、mー、あるいはp-フェニレンジアミン、 2, 4-あるいは2, 6-トリレンジアミン、m-、あ るいはp-キシリレンジアミン、1,5-あるいは、 2, 6ーナフタレンジアミン、4, 4'ージアミノジフ ェニルメタン、4, 4'ージアミノジフェニルエーテ ル、2、2-(4、4'-ジアミノジフェニル)プロパ ン等の一級ジアミン、N, N'ージメチルエチレンジア ミン、N, N'ージメチルー1, 2ージアミノプロパ ン、N, N'ージメチルー1, 3ージアミノプロパン、 N, N' ージメチルー1, 2ージアミノブタン、N, N'ージメチルー1, 3ージアミノブタン、N, N'ー ジメチルー1, 4ージアミノブタン、N, N'ージメチ ルー1, 5ージアミノペンタン、N, N'ージメチルー 1, 6 - ジアミノヘキサン、N, N' - ジメチルー1, 7 ージアミノヘプタン、N, N' ージエチルエチレンジ アミン、N, N'ージエチルー1, 2ージアミノプロパ ン、N, N'ージエチルー1, 3ージアミノプロパン、 N, N' ージエチルー1, 2 ージアミノブタン、N, N'ージエチルー1, 3-ジアミノブタン、N, N'-ジエチルー1, 4 ージアミノブタン、N, N'ージエチ 50

ルー1,6-ジアミノヘキサン、ピペラジン、2-メチ ルピペラジン、2,5-あるいは2,6-ジメチルピペ ラジン、ホモピペラジン、1, 1-ジー(4-ピペリジ ル) ーメタン、1, 2ージー(4ーピペリジル) ーエタ ン、1、3ージー(4ーピペリジル)ープロパン、1、 4-ジー(4-ピペリジル)-ブタン等の二級ジアミン とエピハロヒドリンの縮合により製造されるアミン系エ ポキシ化合物;3、4-エポキシシクロヘキシル-3、 4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ビニル シクリヘキサンジオキサイド、2-(3、4-エポキシ シクロヘキシル) -5、5-スピロ-3、4-エポキシ シクロヘキサンーメタージオキサン、ビス(3、4-エ ポキシシクロヘキシル)アジペート等の脂環式エポキシ 化合物;シクロペンタジエンエポキシド、エポキシ化大 豆油、エポキシ化ポリブタジエン、ビニルシクロヘキセ ンエポキシド等の不飽和化合物のエポキシ化により製造 されるエポキシ化合物;上述の多価アルコール、フェノ ール化合物とジイソシアネートおよびグリシドール等か ら製造されるウレタン系エポキシ化合物等をあげること ができる。

【0021】エピスルフィド化合物の具体例としては、 以上のエポキシ化合物のエポキシ基の一部あるいは全て をエピスルフィド化して得られるエピスルフィド化合物 をあげることができる。

【0022】多価カルボン酸無水物等の具体例としては 上述のエポキシ化合物のところで説明したエピハロヒド リンと反応させる相手の原料として上述したものをあげ ることができる。

【0023】また、以下にポリエピスルフィド中のエピスルフィド基および/またはエポキシ基と反応可能な官能基1個以上と他の単独重合可能な官能基を1個以上有する化合物の代表的具体例を示す。不飽和基を有するエポキシ化合物としては、ビニルフェニルグリシジルエーテル、ビニルベンジルグリシジルエーテル、グリシジルアクリレート、アリルグリシジルエーテル等をあげることができる。不飽和基を有するエピスルフィド化合物としては上記の不飽和基を有するエポキシ化合物のエポキシ基をエピスルフィド化した化合物、例えば、ビニルフェニルチオグリシジルエーテル、ビニルベンジルチオグリシジルエーテル、チオグリシジルメタクリレート、チオグリシジルアクリレート、アリルチオグリシジルエーテル等をあげることができる。

【0024】単独重合可能な官能基を1個以上有する化合物の具体例としては、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、トリエチレン

グリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコール ジアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレ ート、1,3ープチレングリコールジアクリレート、 1, 3-プチレングリコールジメタクリレート、1, 6 ーヘキサンジオールジアクリレート、1,6ーヘキサン ジオールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジ アクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレー ト、ポリプロピレングリコールジアクリレート、ポリプ ロピレングリコールジメタクリレート、2.2ービス 〔4-(アクリロキシエトキシ)フェニル〕プロパン、 2, 2-ビス(4-(メタクリロキシエトキシ)フェニ ル)プロパン、2,2-ビス〔4-(アクリロキシ・ジ エトキシ)フェニル]プロパン、2、2ービス〔4ー (メタクリロキシ・ジエトキシ) フェニル) プロパン、 2, 2-ビス〔4-(アクリロキシ・ポリエトキシ)フ ェニル〕プロパン、2, 2-ビス〔4-(メタクリロキ シ・ポリエトキシ)フェニル)プロパン、トリメチロー ルプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパン トリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラアク リレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレー ト、ビス(2,2,2-トリメチロールエチル)エーテ ルのヘキサアクリレート、ビス(2,2,2ートリメチ ロールエチル) エーテルのヘキサメタクリレート等の1 価以上のアルコールとアクリル酸、メタクリル酸のエス テル構造を有する化合物;アリルスルフィド、ジアリル フタレート、ジエチレングリコールビスアリルカーボネ ート等のアリル化合物;アクロレイン、アクリロニトリ ル、ビニルスルフィド等のビニル化合物;スチレン、α ーメチルスチレン、メチルビニルベンゼン、エチルビニ ルベンゼン、αークロロスチレン、クロロビニルベンゼ 30 ン、ビニルベンジルクロライド、パラジビニルベンゼ ン、メタジビニルベンゼン等の芳香族ビニル化合物等が あげられる。

【0025】また、ポリエピスルフィド中のエピスルフ ィド基および/またはエポキシ基と反応可能でかつ単独 重合も可能な官能基を1個有する化合物の好ましい具体 例としてはエポキシ基あるいはエピスルフィド基を1個 有する化合物をあげることができる。より具体的には、 エチレンオキサイド、プロピレオキサイド、グリシドー ル等のモノエポキシ化合物類、酢酸、プロピオン酸、安 40 息香酸等のモノカルボン酸のグリシジルエステル類、メ チルグリシジルエーテル、エチルグリシジルエーテル、 プロピルグリシジルエーテル、ブチルグリシジルエーテ ル等のグリシジルエーテル類あるいは、エチレンスルフ ィド、プロピレンスルフィド等のモノエピスルフィド化 合物、上述のモノカルボン酸とチオグリシドール(1, 2-エピチオー3-ヒドロキシプロパン) から誘導され る構造を有するチオグリシジルエステル類、メチルチオ グリシジルエーテル(1,2-エピチオプロピルオキシ メタン)、エチルチオグリシジルエーテル、プロピルチ 50

オグリシジルエーテル、ブチルチオグリシジルエーテル 等のチオグリシジルエーテル類をあげることができる。 これらの中でより好ましいものはエピスルフィド基を 1 個有する化合物である。

【0026】本発明のポリエピスルフィド中のエピスルフィド基および/またはエポキシ基と反応可能な官能基を2個以上有する化合物あるいは、これらの官能基1個以上と他の単独重合可能な官能基を1個以上有する化合物とは、硬化重合触媒の存在下、硬化重合し製造することができる。硬化触媒は、前述のアミン類、ホスフィン類、酸類等が使用される。具体例としては、前述のものがここでも使用される。

【0027】さらに、不飽和基を有する化合物を使用す る際には、重合促進剤として、ラジカル重合開始剤を使 用する事は好ましい方法である。ラジカル重合開始剤と は、加熱あるいは紫外線や電子線によってラジカルを生 成するものであれば良く、例えば、クミルパーオキシネ オデカノエート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネ ート、ジアリルパーオキシジカーボネート、ジーnープ ロピルパーオキシジカーボネート、ジミリスチルパーオ キシジカーボネート、クミルパーオキシネオヘキサノエ ート、terーヘキシルパーオキシネオデカノエート、 terープチルパーオキシネオデカノエート、terー ヘキシルパーオキシネオヘキサノエート、 t e r ープチ ルパーオキシネオヘキサノエート、2, 4 - ジクロロベ ンゾイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、 ジクミルパーオキサイド、ジーterーブチルパーオキ サイド等のパーオキサイド類;クメンヒドロパーオキサ イド、terープチルヒドロパーオキサイド等のヒドロ パーオキサイド類;2,2'ーアゾビス(4ーメトキシ -2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'ーアゾ ビス(2-シクロプロピルプロピオニトリル)、2. 2'ーアゾビス(2,4ージメチルバレロニトリル)、 2, 2'ーアゾビスイソブチロニトリル、2, 2'ーア ゾビス(2ーメチルプチロニトリル)、1,1'ーアゾ ビス (シクロヘキサンー1ーカルボニトリル)、1-〔(1ーシアノー1ーメチルエチル)アゾ〕ホルムアミ ド、2-フェニルアゾー4-メトキシー2、4-ジメチ ルーバレロニトリル2、2'ーアゾビス(2ーメチルプ ロパン)、2、2'ーアゾビス(2、4、4ートリメチ ルペンタン)等のアゾ系化合物等の公知の熱重合触媒、 ベンゾフェノン、ベンゾインベンゾインメチルエーテル 等の公知の光重合触媒が挙げられる。これらのなかで好 ましいものは、パーオキサイド類、ヒドロパーオキサイ ド類、アゾ系化合物であり、より好ましいものは、パー オキサイド類、アゾ系化合物であり、最も好ましいもの は、2、2'ーアゾビス(4ーメトキシー2、4ージメ チルバレロニトリル)、2,2'-アゾビス(2-シク ロプロピルプロピオニトリル)、2,2'ーアゾピス (2, 4ージメチルバレロニトリル)、2, 2'ーアゾ

ビスイソブチロニトリル、2, 2, 一アゾビス(2ーメチルブチロニトリル)、1, 1, 一アゾビス(シクロへキサンー1ーカルボニトリル)、1ー〔(1ーシアノー1ーメチルエチル)アゾ〕ホルムアミド、2ーフェニルアゾー4ーメトキシー2, 4ージメチルーバレロニトリル、2、2, 一アゾビス(2ーメチルプロパン)2、2, 一アゾビス、(2、4、4ートリメチルペンタン)等のアゾ系化合物である。またこれらは、全て混合使用することができる。ラジカル重合開始剤の配合量は、組成物の成分や硬化方法によって変化するので一てには決められないが、通常は組成物総量に対して0.01wt%~5.0wt%、好ましくは0.1wt%~2.0wt%の範囲である。

【0028】また、本発明のエピスルフィド化合物を重 合硬化して光学材料を得るに際して、公知の酸化防止 剤、紫外線吸収剤等の添加剤を加えて、得られる材料の 実用性をより向上せしめることはもちろん可能である。 また、本発明のエピスルフィド化合物は重合中に型から 剥がれやすい場合は、公知の外部および/または内部密 着性改善剤を使用または添加して、得られる硬化材料と 型の密着性を制御向上せしめることも必要である。ここ に言う内部密着性改善剤とは、例えば、3-メタクリロ キシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプ ロピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-メルカ プトプロピルトリメトキシシラン等のシラン化合物等を 言い、本発明のエピスルフィド化合物100重量部に対 して0.0001~5重量部使用することができる。逆 に、本発明のエピスルフィド化合物が重合後に型から剥 がれにくい場合は、公知の外部および/または内部離型 剤を使用または添加して、得られる硬化材料の型からの 離型性を向上せしめることも可能である。ここに言う内 部離型剤とは、フッ素系ノニオン界面活性剤、シリコン 系ノニオン界面活性剤、アルキル第4級アンモニウム 塩、燐酸エステル、酸性燐酸エステル、オキシアルキレ ン型酸性燐酸エステル、酸性燐酸エステルのアルカリ金 属塩、オキシアルキレン型酸性燐酸エステルのアルカリ 金属塩、、高級脂肪酸の金属塩、高級脂肪酸エステル、 パラフィン、ワックス、高級脂肪族アミド、高級脂肪族 アルコール、ポリシロキサン類、脂肪族アミンエチレン オキシド付加物等があげられる。

【0029】本発明のエピスルフィド化合物を重合硬化して得るに際し、原料となるポリエピスルフィド、さらには所望に応じて前述の抗酸化成分、染色性向上成分、硬化触媒、不飽和基を有しエピスルフィド基および/またはエポキシ基と反応可能な例えばグリシジルメタクリレート、チオグリシジルメタクリレート(グリシジルメタクリレートのエポキシ基をエピスルフィド化したもの)等を併用する場合、ラジカル重合開始剤、ラジカル重合可能な単量体、さらには、密着性改善剤もしくは内50

部離型剤、既述の抗酸化成分以外の酸化防止剤、紫外線 吸収剤等の添加剤混合後、次の様にして重合硬化してレ ンズ等の光学材料とされる。すなわち、混合後の原料を 必要であれば外部離型剤が塗布されたガラスや金属製の 型に注入し、加熱によって重合硬化反応を進めた後、型 から外し製造される。原料エピスルフィドおよび副原料 の抗酸化成分、染色性向上成分、エピスルフィド基およ び/またはエポキシ基と反応可能な官能基を2個以上有 する化合物、これらの官能基1個以上と他の単独重合可 能な官能基を1個以上有する化合物、これらの単独重合 可能な官能基を1個以上有する化合物、エピスルフィド 基および/またはエポキシ基と反応可能でかつ単独重合 も可能な官能基を1個有する化合物は、単独反応可能な 場合は単独および/または反応可能な他の原料および/ または副原料との組み合わせで、また、単独反応が不可 能な場合は反応可能な他の原料および/または副原料と の組み合わせで、その一部または全量を注型前に触媒の 存在下または非存在下、撹拌下または非撹拌下で-10 0~160℃で、0.1~48時間かけて予備的に反応 せしめた後組成物を調製して注型を行う事も可能であ る。ここで言う単独反応可能とは、原料または副原料が 単独反応が不可能な化合物のみからなる場合、または、 単独反応が不可能でかつ互いに反応不可能な複数の成分 より成る場合を言う。硬化時間は0.1~100時間、 通常1~48時間であり、硬化温度は-10~160 ℃、通常-10~140℃である。重合は所定の重合温 度で所定時間の保持、0.1℃~100℃/hの昇温、 0. 1 ℃~ 1 0 0 ℃/h の降温およびこれらの組み合わ せで行うことができる。また、硬化終了後、材料を50 から150℃の温度で10分から5時間程度アニール処 理を行う事は、本発明の光学材料の歪を除くために好ま しい処理である。さらに必要に応じて染色、ハードコー ト、反射防止、防曇性付与等表面処理を行うことができ る。本発明の硬化樹脂光学材料の製造方法は、さらに詳 しく述べるならば以下の通りである。前述の様に、主原 料および副原料を混合後、型に注入硬化して製造される が、主原料であるエピスルフィドと所望により使用され るエピスルフィド基および/またはエポキシ基と反応可 能な官能基を2個以上有する化合物あるいは、これらの 官能基1個以上と他の単独重合可能な官能基を1個以上 有する化合物、単独重合可能な官能基を1個以上有する 化合物、エピスルフィド基および/またはエポキシ基と 反応可能でかつ単独重合も可能な官能基を 1 個有する化 合物、さらには所望に応じて使用される、抗酸化成分、 硬化触媒、ラジカル重合開始剤、さらには密着性改善 剤、安定剤等は、全て同一容器内で同時に撹拌下に混合 しても、各原料を段階的に添加混合しても、数成分を別 々に混合後さらに同一容器内で再混合しても良い。各原 料および副原料はいかなる順序で混合してもかまわな い。混合にあたり、設定温度、これに要する時間等は基

本的には各成分が十分に混合される条件であればよい が、過剰の温度、時間は各原料、添加剤間の好ましくな い反応が起こり、さらには粘度の上昇を来たし注型操作 を困難にする等適当ではない。混合温度は−20℃から 100℃程度の範囲で行われるべきであり、好ましい温 度範囲は一10℃から50℃、さらにに好ましいのは、 -5℃から30℃である。混合時間は、1分から5時 間、好ましくは5分から2時間、さらに好ましくは5分 から30分、最も好ましいのは5分から15分程度であ る。各原料、添加剤の混合前、混合時あるいは混合後 に、減圧下に脱ガス操作を行う事は、後の中型重合硬化 中の気泡発生を防止する点からは好ましい方法である。 この時の減圧度は0.1mmHgから700mmHg程 度で行うが、好ましいのは10mmHgから300mm Hgである。さらに、主原料、副原料を混合前あるいは 混合後にミクロフィルター等で不純物等を濾過し除去す ることは光学材料の品質をさらに高める上からも好まし い。

[0030]

【発明の効果】本発明の化合物を重合硬化して得られる 硬化樹脂光学材料により、従来技術の化合物を原料とす る限り困難であった高い屈折率と良好なアッベ数のバラ ンスを有する樹脂光学材料に、十分に高い耐熱性と強度 を同時に付与せしめることが可能となった。すなわち本 発明により、レンズの飛躍的な薄肉化と軽量化が実現可 能となった。

[0031]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す るが、本発明はこれらに限定されるものではない。な お、得られた重合物の評価は以下の方法で行った。 折率(nD)、アッベ数(vD):アッベ屈折計を用

> 元素分析值: (分析値)

46.28% Н 6.99% 5 46.43%

マススペクトル (EI):M* 206 (理論分子量206)

赤外吸収スペクトル:620cm-1(エピスルフィド環の伸縮振動)

 1 H-NMR: 3. 2 ppm (m, 2H)

2. 8 ppm (m, 2H)

2. 7 ppm (m, 2H)

2. 4 ppm (m, 2H)

1. 3 ppm (m, 6 H)

¹³ C-NMR: 50. Oppm, 41. 6ppm, 33. 6ppm,

30. 3ppm

さらに、本化合物100重量部にN, Nージエチルエタ ノールアミンをO. 3重量部配合しこれを厚さ2mmに 調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、 80℃で5時間重合硬化し光学材料を得た。得られた材 料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結果 を、表1に示した。

い、25℃で測定した。

耐熱性:5kg荷重ビカット法で針が0.1mm侵入し た温度。

強度:2mm厚の平板の落球試験において、試験板中の 50%の枚数が破損する破壊エネルギー。

【0032】実施例1

撹拌機、温度計、窒素導入管を装着したフラスコにテト ラブチルアンモニウムブロマイド50gをβーメチルエ ピクロルヒドリン11. 52kg (108. 1mol) に溶かし入れ、液温28~36℃で硫化水素1.84k g (54.05mol)を通じた。液温を10℃まで冷 却し、20%食塩水47.4kgを加えた。その後、同 温度で35%水酸化ナトリウム16.67kg(14 5. 9 m o 1) を滴下した。反応混合物にトルエン 2 5. 21を加え抽出し、トルエン層を水33. 61で2 回洗浄した。トルエン層を硫酸ナトリウムで乾燥させた 後、溶媒を留去し、純度98%(GC測定)で無色液状 の2, 6-ジメチルー1, 2:6, 7-ジエポキシー4 ーチアヘプタン7. 84kg (理論量83%)を得た。 次いで、撹拌機、温度計、窒素導入管を装着したフラス コに2,6-ジメチルー1,2:6,7-ジエポキシー 4 ーチアヘプタン 4 3 5. 7 g (2. 5 m o 1 とチオ尿 素761.2g(10.0mol)および無水酢酸4 1. 0g(0.4mol) さらに溶媒としてトルエン 2. 6 L およびメタノール2. 6 L 仕込み、28℃で8 時間30分間反応した。反応後トルエンで抽出し、10 %硫酸水溶液で洗浄、水洗後過剰の溶媒を留去したとこ ろ433. 4g(収率84%)の生成物を得た。元素分 析、質量分析、NMR分析、IR分析から、生成物は 2, 6-ジメチルー1, 2:6, 7-ジエピチオー4-チアヘプタンと判明した。

(計算值)

46.55%

6.84%

46.61%

【0033】実施例2

拠拌機、温度計、窒素導入管を装着したフラスコに、テ トラプチルアンモニウムプロマイド50gをβーメチル エピクロルヒドリン11.52kg(108.1mo 1) に溶かし入れ、さらに、水酸化ナトリウム80g (2.0mol)を水800mlに溶かした水溶液を加

え、液温28~36℃で硫化水素1.84kg (54. 05mol)を通じた。液温を10℃まで冷却し、20 %食塩水 4 7. 4 k g を加えた。その後、同温度で 3 5 %水酸化ナトリウム 1 6. 67 kg (145.9 mo 1)を滴下した。反応混合物にトルエン25.2Lを加 えて反応物を抽出し、トルエン層を水33.6kgで2 回洗浄した。トルエン層を硫酸ナトリウムで乾燥させた 後、溶媒を留去し、純度98%(GC)で無色液状の 2, 6-ジメチルー1, 2:6, 7-ジエポキシー4-チアヘプタン7.92kg (理論良の84%) を得た。 次いで、攪拌機、温度計、窒素導入管を装備したフラス コに2,6ージメチルー1,2:6,7ージエポキシー 4-チアヘプタン435.7g(2.5mol)とチオ 尿素 5 7 0. 9 g (7. 5 m o 1) および無水酢酸 4 1. 0g(0.4mol) さらに溶媒としてトルエン 2. 6 L およびメタノール 2. 6 L 仕込み、28℃で8 時間30分間反応した。反応後、反応物をトルエンで抽 出し、10%硫酸水溶液で洗浄、水洗後過剰の溶媒を留 去したところ410.4gの生成物を得た。元素分析、 質量分析、NMR分析、IR分析から、生成物は2,6 ージメチルー1,2:6,7ージエピチオー4ーチアへ プタンと判明した。得られた生成物は、NMRスペクト ルより、(1) 式中の $R^1 = CH_3$, R^2 および $R^3 =$ H、R⁴ = C H₃ 、X中のSの個数は、三員環を構成す るSと〇の合計に対して平均で85%であった。重合硬 化後、得られた材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および

元素分析值: (分析值) C 42.61%

C 42.61% 42.81% H 6.59% 6.39% S 53.73% 50.80%

マススペクトル (E I): M*·・252 (理論分子量252) 赤外吸収スペクトル:620cm⁻¹ (エピスルフィド環の伸縮振動)

¹ H-NMR: 3. 1 ppm (m, 2 H)

2. 9-2. 6 ppm (m, 11H)

1. 2 ppm (m, 3 H)

13 C-NMR: 43. 8 ppm, 41. 6 ppm, 41. 0 ppm,

40. 1 ppm, 32. 7 ppm, 32. 5 ppm,

25. 7 ppm, 21. 0 ppm

さらに、本化合物100重量部にN, Nージエチルエタノールアミンを0.3重量部配合しこれを厚さ2mmに 40 調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結果を表1に示した。

【0035】実施例4

オ)プロパンと判明した。

(計算値)

実施例3において、1, 2ージメルカプトプロパンの代わりに2, 3ージメルカプトブタンを使用する以外は実施例3を繰り返した。得られた生成物は、元素分析、質量分析、NMR分析、IR分析から、2, 3ービス(β -エピチオプロピルチオ)ブタンと判明した。

元素分析值:		(分析	値))	(計算値)			
	С	44.	9.	1 %	45.	0	7	%
	Н	6.	9	9 %	6.	8	1	%
	S	47.	9	9 %	48.	1	3	%
マフフペカト	L (EI)	· 1/4.		2 6 6	(加金八フ島	2	_	c >

マススペクトル (EI): M· 266 (理論分子量266) 赤外吸収スペクトル: 620cm⁻¹ (エピスルフィド環の伸縮振動)

強度を測定した結果を表1に示した。

【0034】実施例3

36

1, 2-ジメルカプトプロパン1. 0mol(108. 2g) とエピクロルヒドリン2. 0mol (185. 1 g)を、液温を10℃まで冷却し、水酸化ナトリウム1 0 mm o l (0.4g) を水 4 m l に溶かした水溶液を 加え、この温度で1時間撹拌した。その後、液温を40 -45℃前後に保ちながら2時間撹拌した。室温に戻 し、水酸化ナトリウム2mol(80.0g)を水80 mlに溶かした水溶液を、液温を40-45℃前後に保 ちながら滴下しその後、液温を40−45℃前後に保ち ながら3時間撹拌した。反応混合物に水100mlを加 え、トルエン200mlで抽出し、トルエン層を水10 0mlで3回洗浄した。トルエン層を硫酸ナトリウムで 乾燥させ、溶媒を留去し、無色透明液体の1, 2-ビス (ジグリシジルチオ) プロパンを220.3g (理論量 の100%) で得た。次いで得られた生成物 1.0 mo 1(220.2g)とチオ尿素3mol(228.4 g) および無水酢酸 0. 1 mol (10.2g) さらに 溶媒としてトルエン0. 4 L およびメタノール0. 4 L 仕込み、20℃で10時間反応した。反応後トルエンで 抽出し、10%硫酸水溶液で洗浄、水洗後過剰の溶媒を 留去したところ222.2g(収率88%)の生成物を 得た。元素分析、質量分析、NMR分析、IR分析か

ら、生成物は1, 2-ビス(β-エピチオプロピルチ

 1 H-NMR: 3. 1 ppm (m, 4H)

2. 9-2. 6 ppm (m, 8H)

1. 2 ppm (m, 6H)

13 C-NMR: 44. 7 ppm, 41. 4 ppm, 32. 6 ppm,

25. 8ppm, 18. 5ppm

さらに、本化合物100重量部にN, Nージエチルエタ ノールアミンを0.3重量部配合しこれを厚さ2mmに 調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、 80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた 材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結 10 果を表1に示した。

【0036】実施例5

1, 5ージメルカプトー2, 4ージ(メルカプトメチ ル) -3-チアペンタン1. 0mol (246.5g) とエピクロルヒドリン4. 0 mol (370. 1g) を 液温を10℃まで冷却し、水酸化ナトリウム20mmo 1(0.8g)を水8mlに溶かした水溶液を加え、こ の温度で1時間撹拌した。その後、液温を40-45℃ 前後に保ちながら2時間撹拌した。室温に戻し、水酸化 ナトリウム4mol (160.0g) を水160mlに 20 溶かした水溶液を、液温を40−45℃前後に保ちなが ら滴下しその後、液温を40−45℃前後に保ちながら

ルエン400mlで抽出し、トルエン層を水200ml
で3回洗浄した。トルエン層を硫酸ナトリウムで乾燥さ
せ、溶媒を留去し、無色透明液体の1,5-ビス(ジグ
リシジルチオ)-2,4-ビス(ジグリシジルチオメチ
ル) -3-チアペンタンを470.8g (理論量の10
0%) で得た。次いで得られた生成物 1. 0 m o 1 (4
70.8g) とチオ尿素 5 mol (380.6g) およ
び無水酢酸 0.2 mol (20.5g) さらに溶媒とし
てトルエン1. 3 L およびメタノール1. 3 L 仕込み、
20℃で10時間反応した。反応後トルエンで抽出し、
10%硫酸水溶液で洗浄、水洗後過剰の溶媒を留去した
ところ480.1g(収率90%)の生成物を得た。元
素分析、質量分析、NMR分析、IR分析から、生成物
は1, 5 ービス (β ーエピチオプロピルチオ) -2 , 4
ービス (βーエピチオプロピルチオメチル) -3ーチア
ペンタンと判明した。
(計質値)

3時間撹拌した。反応混合物に水200m1を加え、ト

元素分析值:	(分析值)	(計算值)
С	40.28%	40.41%
Н	6.99%	5.65%
S	53.73%	53.94%
マススペクトル(EI)):M* 534	(理論分子量534)

マススペク

赤外吸収スペクトル: 620 cm⁻¹ (エピスルフィド環の伸縮振動) 1 H-NMR: 3. 2-2. 6 ppm (m, 30H)

¹³ C-NMR: 43. 8 ppm, 42. 4 ppm, 38. 6 ppm,

32. 5ppm, 25. 7ppm

さらに、本化合物100重量部にN,Nージエチルエタ ノールアミンを 0.3重量部配合しこれを厚さ 2 mmに 調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、 80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた 材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結 果を表1に示した。

【0037】実施例6

実施例5において、1,5-ジメルカプト-2,4-ジ

(メルカプトメチル) -3-チアペンタンの代わりに 1, 11ージメルカプトー4, 8ージ(メルカプトメチ ル) -3, 6, 9-トリチアウンデカンを使用する以外 は実施例5を繰り返した。得られた生成物は、元素分 析、質量分析、NMR分析、IR分析から、1,11-ーエピチオプロピルチオメチル) -3, 6, 9-トリチ アウンデカンと判明した。

3 シブルカフトー 2,	, 4		ノソンアルンと刊明し
元素分析值:	(分析	f值)	(計算値)
С	40.	17%	40.33%
H	6.	00%	5.85%
S	53.	63%	53.83%
フフフペカレル (アエ)		0 - 4	/7四級ハラ思。 - ・、

マススペクトル (EI): M* 654 (理論分子量654)

赤外吸収スペクトル:620 c m-1 (エピスルフィド環の伸縮振動)

 1 H-NMR: 3. 1-2. 5 ppm (m, 38H)

13 C-NMR: 43. 8 ppm, 43. 5 ppm, 38. 6 ppm, 38. 3ppm, 34. 7ppm, 32. 5ppm,

25. 7 ppm

さらに、本化合物 $1\,0\,0$ 重量部にN,N - ジエチルエタ ∞ \mathcal{L} $\mathcal{L$

調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、 80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた 材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結 果を表1に示した。

【0038】実施例7

実施例5において、1,5ージメルカプトー2,4ージ (メルカプトメチル) -3-チアペンタンの代わりに

元素分析值: (分析值) (計算值) 40.15% 40.33% 5.85% Н 5.98% S 53.67% 53.83% マススペクトル (EI): M+ 654 (理論分子量654)

 1 H-NMR: 3. 1-2. 5 ppm (m, 38H)

赤外吸収スペクトル:620cm⁻¹ (エピスルフィド環の伸縮振動)

¹³ C-NMR: 45. 6 ppm, 43. 5 ppm, 40. 6 ppm,

38. 3ppm, 38. 0ppm, 34. 7ppm,

32. 4 ppm, 25. 7 ppm

さらに、本化合物 1 0 0 重量部にN, Nージエチルエタ ノールアミンを O. 3 重量部配合しこれを厚さ 2 mmに 調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、 80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた 材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結 果を表1に示した。

【0039】実施例8

実施例5において、1,5ージメルカプトー2,4ージ

元素分析值: (分析値) (計算值) 40.15% 40.33% 6.01% 5.85% 53.83% 53.66%

赤外吸収スペクトル:620cm-1 (エピスルフィド環の伸縮振動)

 1 H-NMR: 3. 1-2. 5 ppm (m, 38H)

¹³ C-NMR: 45. 9 ppm, 45. 6 ppm, 43. 8 ppm,

43. 5ppm, 40. 6ppm, 38. 3ppm,

38. 0 ppm, 35. 1 ppm, 34. 7 ppm,

32. 4 ppm, 25. 7 ppm

さらに、本化合物100重量部にN、Nージエチルエタ ノールアミンを O. 3重量部配合しこれを厚さ 2 mmに 調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、 80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた 40 材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結 果を表1に示した。

【0040】実施例9

トリメチロールプロパントリス(チオアセテート) 1. 3mol (445.2g) とエピクロルヒドリン4.0 mol (370.1g)を液温を10℃まで冷却し、水 酸化ナトリウム20mmo1(0.8g)を水8mlに 溶かした水溶液を加え、この温度で1時間撹拌した。そ の後、液温を40-45℃前後に保ちながら2時間撹拌 した。室温に戻し、水酸化ナトリウム4mol(16

1. 11ージメルカプトー5, 7ージ(メルカプトメチ ル) -3, 6, 9-トリチアウンデカンを使用する以外 は実施例5を繰り返した。得られた生成物は、元素分 析、質量分析、NMR分析、IR分析から、1,11- \forall ス (β-エピチオプロピルチオ)-5, 7- \forall ス (β ーエピチオプロピルチオメチル) -3, 6, 9-トリチ アウンデカンと判明した。

(メルカプトメチル) -3-チアペンタンの代わりに 1、11-ジメルカプト-4、7-ジ(メルカプトメチ ル) -3, 6, 9-トリチアウンデカンを使用する以外 は実施例5を繰り返した。得られた生成物は、元素分 析、質量分析、NMR分析、IR分析から、1,11-UZ (β-I - ーエピチオプロピルチオメチル) -3, 6, 9-トリチ アウンデカンと判明した。

マススペクトル (EI): M+ 654 (理論分子量654)

 0.0g)を水160mlに溶かした水溶液を、液温を 40−45℃前後に保ちながら滴下しその後、液温を4 0-45℃前後に保ちながら3時間撹拌した。反応混合 物に水200mlを加え、トルエン400mlで抽出 し、トルエン層を水200mlで3回洗浄した。トルエ ン層を硫酸ナトリウムで乾燥させ、溶媒を留去し、無色 透明液体のトリメチロールプロパントリス(グリシジル チオアセテート)を657.2g(理論量の99%)で 得た。次いで得られた生成物 1. 0 m o l (5 1 0. 7 g) とチオ尿素 5 mol(380.6g) および無水酢 酸0.2mol(20.5g) さらに溶媒としてトルエ ン1. 3 Lおよびメタノール1. 3 L仕込み、20℃で 10時間反応した。反応後トルエンで抽出し、10%硫 酸水溶液で洗浄、水洗後過剰の溶媒を留去したところ2

59.9g(収率47%)の生成物を得た。元素分析、 質量分析、NMR分析、IR分析から、生成物はトリメ チロールプロパントリス(β ーエピチオプロピルチオアセテート)と判明した。

元素分析值:		(分析値)	(計算值)		
	С	42.77%	42.98%		
	Н	5.69%	5.41%		
	S	34.13%	.34.43%		

マススペクトル (EI): M*· 558 (理論分子量558)

赤外吸収スペクトル:1740cm⁻¹(エステル結合の伸縮振動)

620 c m-1 (エピスルフィド環の伸縮振動)

¹ H-NMR: 3. 8 ppm (s, 6H)

3. 1 ppm (m, 3H)

2. 9 ppm (s, 6H)

2. 9-2. 6 ppm (m, 12H)

0. 9 ppm (s, 3H)

13 C-NMR: 171. Oppm, 69. Oppm, 43. 6ppm,

36. 0 ppm, 32. 5 ppm, 29. 0 ppm,

25. 7 ppm, 13. 6 ppm

さらに、本化合物 1 0 0 重量部に N, N ージエチルエタ ノールアミンを 0. 3 重量部配合しこれを厚さ 2 mmに 調節した 2 枚のガラス板からなるモールド中に注入し、 8 0 ℃で 2 0 時間重合硬化し光学材料を得た。得られた 材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結 果を表 1 に示した。

【0041】 実施例10

実施例9において、トリメチロールプロパントリス(チオアセテート)の代わりにペンタエリスリトールテトラ キス(チオアセテート)を使用する以外は実施例9を繰り返した。得られた生成物は、元素分析、質量分析、NMR分析、IR分析から、ペンタエリスリトールテトラキス(βーエピチオプロピルチオアセテート)と判明した。

元素分析值:	(分析值)	(計算值)
С	41.44%	41.64%
Н	5. 22%	5.03%
S	35.35%	35.58%
マススペクトル(E	I): M*· 720	(理論分子量720)

赤外吸収スペクトル: 1740 c m-1 (エステル結合の伸縮振動)

620cm⁻¹(エピスルフィド環の伸縮振動)

 1 H-NMR: 3. 8 ppm (s, 8H)

3. 1 ppm (m, 4 H)

2. 9 ppm (s, 8H)

2. 9-2. 6 ppm (m, 16H)

13 C-NMR: 171. Oppm, 63. Oppm, 43. 6ppm,

36. Oppm, 32. 5ppm, 29. 3ppm

25. 7 ppm

さらに、本化合物 1 0 0 重量部に N, N ージエチルエタ ノールアミンを 0.3 重量部配合しこれを厚さ 2 mmに 40 調節した 2 枚のガラス板からなるモールド中に注入し、 8 0 ℃で 2 0 時間重合硬化し光学材料を得た。得られた 材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結 果を表 1 に示した。

【0042】実施例11

実施例9において、トリメチロールプロパントリス(チオアセテート)の代わりにペンタエリスリトールテトラキス(β-エピチオプロピルチオプロピオネート)を使用する以外は実施例9を繰り返した。得られた生成物は、元素分析、質量分析、NMR分析、IR分析から、ペンタエリスリトールテトラキス(β-エピチオプロピルチオプロピオネート)と判明した。

元素分析值:	(分析值)	(計算值)		
С	44.63%	44.82%		
Н	5.98%	5.71%		
S	32.88%	33.01%		
マススペクトル(FI)):M• 776	(理論分子費776)		

赤外吸収スペクトル: 1740 c m⁻¹ (エステル結合の伸縮振動) 620 c m⁻¹ (エピスルフィド環の伸縮振動)

¹ H-NMR: 3. 8 ppm (s, 8 H)

3. 1 (m, 4H)

2. 9-2. 6 (m, 16H)

2. 5-2. 4 (m, 16H)

13 C-NMR: 172. Oppm, 63. 7ppm, 43. 9ppm,

35. 6ppm, 32. 5ppm, 29. 3ppm

27. 8 ppm, 25. 7 ppm

さらに、本化合物100重量部にN, Nージエチルエタ 10 ノールアミンを0.3重量部配合しこれを厚さ2mmに 調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた 材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結果を、表1に示した。

【0043】比較例1

攪拌機、温度計、窒素導入管を装着したフラスコに、テ トラブチルアンモニウムブロマイド100gをエピクロ ルヒドリン20.0kgに溶かし入れ、液温35~40 ℃で硫化水素 3. 5 kgを通じた。その後、21%食塩 20. 水76.0Lを加え、3℃に冷却した後、同温度に保ち ながら35%水酸化ナトリウム18.5Lを滴下した。 反応後2時間、同温度で攪拌を続けた。反応混合物にト ルエン50.1 Lを加え、反応物を抽出し、トルエン層 を水20.01で3回洗浄した。トルエン溶媒を留去し た後、減圧蒸留(60~65℃/30Pa)し、純度9 9%(GC)で無色液状のジグリシジルスルフィド7. 9 k gを得た。次いで、攪拌機、温度計、窒素導入管を 装着したフラスコにジグリシジルスルフィド365.0 gとチオ尿素 7 6. 2 g および無水酢酸 4 3. 8 g さら に溶媒としてトルエン1.6 Lおよびメタノール2.7 Lを仕込み、20℃で9時間反応した。反応後、反応物 をトルエン4.3 Lで抽出し、10%硫酸水溶液520 mlで洗浄、水520mlで4回洗浄後、過剰の溶媒を 留去したところ332.0gの生成物を得た。元素分 析、質量分析、NMR分析、IR分析から、生成物はビ ス(β-エピチオプロピルチオ)スルフィドと判明し た。ビス (β-エピチオプロピルチオ) スルフィド10 0重量部にN. Nージエチルエタノールアミンを0.3 重量部配合し、これを厚さ2mmに調節した2枚のガラ 40 ス板からなるモールド中に注入し、80℃で2時間重合 硬化し、光学材料を得た。得られた材料の屈折率、アッ べ数、耐熱性および強度を測定した結果を表2に示し た。

10 【0044】比較例2

1, 2ービス(β ーエピチオプロピルチオ)エタン100重量部にN, Nージエチルエタノールアミンを0.3 重量部配合してれを厚さ2mmに調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結果を表2に示した。

【0045】比較例3

ビス(βーエピチオプロピルチオエチル)スルフィド100重量部にN,Nージエチルエタノールアミンを0.3重量部配合しこれを厚さ2mmに調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結果を表2に示した。【0046】比較例4

1,3-ビス(β -エピチオプロピルチオエチル)シクロヘキサン100重量部にN,N-ジエチルエタノールアミンを0.3重量部配合しこれを厚さ2mmに調節した2枚のガラス板からなるモールド中に注入し、80℃で20時間重合硬化し光学材料を得た。得られた材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結果を表2に示した。

【0047】比較例5

1,8-ジメルカプト-4-メルカプトメチルー3,6 ージチアオクタン48重量部とメタキシリレンジイソシアネート52重量部の混合物に硬化触媒としてジプチルスズクロライドを混合物100重量部に対して0.1重量部配合後均一液とし、さらに10mmHgの減圧下十分に脱気を行った。ついでモールドに注入後、オープン中で80 $^{\circ}$ 、20時間重合硬化した。得られた材料の屈折率、アッベ数、耐熱性および強度を測定し結果を表2に示した。

[0048]

【表1】

実施例	化合物	nь	ם ע	耐熱性	強度
- 1	2, 6-3° }f*-1, 2:6, 7-3° xt° f*- 4-f7^7° }>	1.67	39	130℃	1.5J
- 2	式(1)のI中のSの個数がSと0の合計に対し平均で85%である2,6-ジメチル-1.2:6.7-ジュピチホ-4-チアヘプタン	1.66	40	130℃	1.2J
- 3	1, 2-t° λ(β-xt° f † 7° ¤t° Nf †) - 7° ¤Λ° ソ	1.69	37	150℃	1.45
- 4	2, 3-t*x(β -xt*fオプ¤t*ルテオ)- プタン	1.68	38	>180℃	1.35
- 5	1,5-t°x(β-xt°f47°pt' μf4)- 2,4-t°x(β-xt°f47'pt' μf4	1.70	36	>180℃	1.4J
- 6	1, 11-t° x (β - x t° f x 7° p t° ν f x) - 4, 8-t° x (β - x t° f x 7° p t° ν f x	l. 70	36	150℃	1. 2J
- 7	l, 11-t゚ス(β-エt゚fオプロt゚ルチオ) -5,7-t゚ス(β-エt゚fオプロt゚ルチオ メチル)-3,6,9-トリチアウンテ゚カン	1.70	36	155℃	1.2J
- 8	1,11-t*ス(β-エt*fオプロピルチオ) -4,7-t*ス(β-エt*fオプロピルチオ メチル)-3,6,9-トリチアウンデカン	1.70	36	165℃	1.2J
- 9	トリメチロールフ゜ロハ゜ントリス(B -エヒ゜チオー フ゜ロヒ゜ルチオアセテート)	1.62	43	120°C	1.7J
- 1 O _.	へ、ソタエリスリトールテトラネス(B -エヒ、チオー フ゜ロヒ、ルチオアセテート)	1.63	42	140℃	1.6J
- 1 1	へ、ソタエリスリトールテトラキス(8 -エヒ、チオー フ、ロヒ、ルチオフ、ロヒ、オネート)	1.62	43	120℃	1.7J

[0049]

【表2】

比較例					
- 1	ビス (βーエピチオプロピルチオ) スルフィド	1.58	45	105°C	0.5J
- 2	1,2-t°Z(β-it°f†7°Ut°Mf†) 197	1.70	3.8	105℃	0.8J
- 3	t° % (& - i t° f #7° 0 t° & f # i f &) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	1.70	36	95°C	0.7J
- 4	1,3-t°Z(8-1t°f47°0t°Nf4 xfh}>>>0v4+y>	1.66	40	90°C	0.8J
- 5	1,8-シェメルカフ。ト-4-メルカフ。ト メチホ-3,6-シェチアオクチン/メタキシリレン シェイソシアネート=48/52	.1.66	32	75℃	2.0J

フロントページの続き

(51) Int .C1.6
// C O 7 D 303/34

識別記号

FΙ

C O 7 D 303/34